フェムト秒パルスレーザーによる 石英ガラス三次元積層造形技術の開発

レーザー技術総合研究所 レーザー技術開発室 主任研究員・室長 本越 伸二 (2019 年度 一般研究開発助成 AF-2019208-B2)

キーワード:レーザー,三次元造形,石英ガラス

1. 研究の目的と背景

三次元造形(3D プリンティング)技術は,現在,模型 製作から,医療用サンプル,土木・建築部品,さらには宇 宙航空機器にまで応用範囲が広がっている.また従来のプ ラスチック樹脂だけでなく,金属や半導体材料などの利用 も進み,今後更に応用が広がることが期待されている.し かしながら,光学分野,特に光学素子への適応は未だ行わ れていない.射出成型やプレス法,エッチング加工により 表面に構造を持つ光学素子,例えばフレネルレンズや回折 格子などは広く利用されている.これらが三次元造形技術 により加工できれば,マスクや金型が不要になり低コスト 化が可能になるだけでなく,従来技術では不可能であった 複雑な構造形成も可能になり新しい光学設計が拓かれる.

我々はシリコーンオイルのメチル基を酸素に置換する ことにより石英ガラスになることに着目し,紫外レーザー によるガラス化に取り組んできた¹⁾.

$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ [-0 & -Si \\ I \\ CH_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1) \\ (1) \\ (1) \end{bmatrix}$$

Si と C の結合エネルギーは, 105 kcal/mol であり, 波長 272 nm 以下の紫外光を照射することにより切断が可能である. 結果, 紫外レーザー光を照射することにより, シリコーン オイルのガラス化は確認したが, 微細な構造形成まで至ら なかった¹⁾.

本研究では、レーザー照射によりシリコーンオイルのガ ラス化に伴った光学特性の変化を評価し、ガラス化に必要 なレーザー条件を明らかにするとともに、フェムト秒パル スレーザーによる多光子吸収過程を用いて紫外レーザー と同様のガラス化が可能であることを明らかにした.

2. 光学特性の評価方法と測定光学系

レーザー照射に対するシリコーンオイルのガラス化を 評価するため,干渉分光法を用いて表面反射光の計測およ び解析を行い,屈折率および厚さを評価した^{2,3)}.

図 1 に干渉分光法による反射光計測の光学配置図を示 す.タングステンランプから出射した白色光はコリメート レンズを通った後,試料表面に照射される.試料からの反 射光は捕集レンズにより光ファイバ(コア径 200 µm)に 集光され分光器へと導かれる. 捕集レンズの焦点距離 50 mmと, 試料とレンズ間, レンズとファイバ端面の間の距 離から, 試料表面上の空間分解能は 800 µm と求まった. また二つのレンズの距離と, 試料までの距離から, 白色光 は約 10°で試料に入射される.

シリコーンオイル塗布前の基板のみの反射率 R はフレ ネルの式より

$$R = \left(\frac{n_s - n_0}{n_s + n_0}\right)^2 \tag{1}$$

で表される.ここで ns, no はそれぞれ基板および空気の屈 折率を示す.シリコンウェハの屈折率はデータベースが存 在するため,シリコンウェハ基板からの理論的な反射率は 求まる.ランプの発光スペクトル,光学系の損失,検出器 の感度特性に依存する反射スペクトルをシリコンウェハ 基板の理論反射率によって校正した.





厚さ d のシリコーンオイルを塗布した時の反射率は,

$$R = \frac{\rho_1^2 + \rho_2^2 + 2\rho_1 \rho_2 \cos 2\delta}{1 + (\rho_1 \rho_2)^2 + 2\rho_1 \rho_2 \cos 2\delta}$$
(2)

で表される. ここで

$$\rho_1 = \frac{n_{oil} - n_0}{n_{oil} + n_0}$$
$$\rho_2 = \frac{n_s - n_{oil}}{n_s + n_{oil}}$$
$$\delta = \frac{2\pi n_{oil} d}{\lambda}$$

である. noil はシリコーンオイルの屈折率であり、 んは光 の波長である.シリコーンオイルの厚さや屈折率が一定で あっても,光の波長により位相δが変化するため反射率が 周期的に変化することを示している. 言い換えると, 波長 に対する反射率の変化からシリコーンオイルの屈折率,膜 厚を求めることができる.図2にスピンコーターを用いて, シリコンウェハ上にシリコーンオイルを塗布した時の反 射率特性を示す.比較のために、シリコンウェハ基板表面 の反射率特性も示す.上述したように、シリコーンオイル の反射率は波長に対して周期的に変化をする.式(2)を用 いてフィッティング解析を行うことによりシリコーンオ イルの屈折率と膜厚を求めた.ここで注目する点は、シリ コーンオイル反射率のピーク部分がシリコンウェハ表面 反射率よりも高くなっている点である. これはシリコーン オイル屈折率が不均一であることを示している.空気と接 するシリコーンオイルは大気を取り込むことにより低屈 折率になったと予想される. そのため、 シリコーンオイル の屈折率 noil は空気側 (Outer) と基板側 (Inner) で異なる ものとして解析を行った. 例えば, 図2の反射率特性を解 析した結果、シリコーンオイルの屈折率は 1.305 (Outer) と 1.424 (Inner), 膜厚は 1168 nm として求まった.

3. 紫外レーザー照射装置

シリコーンオイルをガラス化するための紫外レーザー 装置には、波長 193 nmのArFエキシマレーザー(LAMBDA PHISIK 社 COMPeX100)を使用した.出射したレーザー 光は開口径 10 mmのアパーチャーにより一様な強度分布 を取り出し、焦点距離 500 mmのレンズを用いて試料上で 約5 mm[®]になるように調整した.照射レーザー光のエネル ギーは、レーザー装置の印加電圧により調整し、ビームス プリッターの反射光をエネルギーモニター (OPHIR 社) で計測した.レーザーパルスの繰返し周波数は 5Hz に固 定し,照射パルス数およびエネルギーをパラメータに照射 後のシリコーンオイルの光学特性を評価した.

シリコーンオイル試料は、シリコンウェハ基板上にスピ

ンコーターを用いてコートした.スピンコーターの回転数 および回転時間は,7000 rpm,100秒で固定し,コート後 の一様性,時間的安定性は干渉分光法により確認した.ま たレーザー照射後,スピンコーターと有機溶剤により残留 したシリコーンオイルを除去した後,試料表面の光学特性 を測定した.



図 3 レーザー照射後のシリコーンオイル
反射率特性.照射エネルギー密度
8mJ/cm²

4. 紫外レーザー照射結果

照射エネルギー密度を 8 mJ/cm²に固定し,照射パルス 数 10,000~40,000 パルスに変えた場合の試料表面の反射 率特性を図 3 に示す.残留したシリコーンオイルは除去さ れているので,レーザー照射されていない部分の反射率特 性はシリコン基板(点線)と一致する.照射 10,000 パル スではシリコン基板の反射率よりも僅かに低下したが周 期的な反射率変化が確認できない.この結果,10,000 パル ス照射でガラス化されたシリコーンオイルは有機溶剤に より除去され,シリコン表面の改質または荒れにより反射 率が低下したものと考えられる.パルス数20,000 パルス, 40,000 パルスでは、周期的な反射率変化も確認され,有機 溶剤で除去されずにガラス化したシリコーンオイルが存 在していることが分かる.これら2つの反射率特性から求 められた屈折率,膜厚を表1にまとめた.基板側の屈折率 (Inner)はパルス数の増加に従い低下した.また空気側 (Outer)については大気に近い屈折率となった.石英ガ ラスの屈折率は1.46 であり、レーザー照射によってガラ ス化されたシリコーンオイルはポーラス状態であると考 えられる.一方,厚さは20,000 パルスで一度薄くなった

たられる. 一方, 厚さは 20,000 ハルス (一度薄くなろた が, 40,000 パルスで厚くなった. ガラス化することで薄く なることを予想していたが厚くなることは更に解析が必 要である. また, 照射エネルギー密度を 4 mJ/cm² とした 場合には, 同じ 40,000 パルスでも洗浄後にガラス化され た痕跡は残らなかった.

表1 レーザー照射後のシリコーンオイル屈折率

と膜厚

パルス数	屈折率		膜厚
	Outer	Inner	[nm]
照射前	1.305	1.424	1168
20,000	1.059	1.315	956
40,000	1.081	1.215	1216

5. 積層試験

積層が可能であることを確認するために,図4に示すように,照射位置を1mmずつ移動してレーザー照射を行い, 屈折率および膜厚を評価した.照射レーザーエネルギー密度は8mJ/cm²,1回の照射パルス数は20,000パルスで一定とした.基板にはシリコンウェハを使用し,有機溶剤で洗浄した後,シリコーンオイルを約1µmスピンコーターにて塗布し,レーザー照射を行った.照射後,有機溶剤にて残留オイルを除去し分光反射率を測定.その後,再度シリコーンオイルを約1µm塗布した後,1mm照射位置をずらしてレーザー照射を行った.これを4回行い最終の分光反射率を測定した.

図5に分光反射率から解析された(a)Inner 屈折率と(b)膜 厚の結果を示す.それぞれの横軸は分光反射率計測時の試 料位置を移動することにより一次元の空間分布として示 した.1回目照射では屈折率1.2をピークにした凸分布が 形成されていることが分かった.その屈折率分布は,2回 目照射により最大1.31まで増加し,照射位置を1mm移動 したことによりガラス化した部分の幅も広がった.3回目,



(b)

図5 積層照射による(a)屈折率と(b)膜厚

4回目と照射を繰り返した結果,照射位置の移動量に従い ガラス化部分も広がった.しかしながら、ピークの屈折率 は 1.31 以上に大きくならないことが分かった. これは照 射レーザービーム径約5mmに比べて、ガラス化した幅が 4 mm 程度しかないため、1回目照射と3回目照射ではビ ームの重なりが少なかったためと考えられる. 膜厚は屈折 率が 1.05 以上の位置について示した. 1 回目の照射では 4mm の幅に対して厚さ約 1000 nm でガラス化しているこ とが分かる. 屈折率の分布と重ねるとガラス化による凝縮 などはなくシリコーンオイルから SiO2 へ組成変化(屈折 率変化)のみが起こっていることが伺える.2回目照射に より膜厚は約2000 nm まで厚くなる. これはスピンコート による塗布された厚さ(約1 µm)がそのまま積層されて いることを意味している.しかしながら,3回目,4回目 照射では僅かな増加に留まっている.この原因は、シリコ ーンオイルの塗布方法がスピンコーターであるため約2 umの凸部には十分にオイルが残らなかったこと. また屈 折率変化の場合と同様にビームの重なりが少なかったた めと考えられる.

図 6 に微分干渉顕微鏡により観察した積層部分の像を 示す. 図の下部はシリコンウェハ表面であり,2回目照射 と3回目照射の間の位置のイメージである.右から1回目 照射,2回目照射と順番に層が重なってガラス化している 様子が確認できる.



図6 積層ガラス化したシリコーンオイル

6. フェムト秒パルスレーザーによるガラス化

数100 fs 以下のレーザーパルスの場合,多数の光子エネ ルギーを短時間に材料に照射することができるために,材 料の持つバンドギャップエネルギーを越えて電子エネル ギーを遷移することが可能である.例えば,波長 800 nm の光の光子エネルギーは 1.55 eV (35.73 kcal/mol) である. 3 つの光子によりシリコーンオイル内の Si-C 結合エネル ギー (105 kcal/mol) を越え切断できる.

これを確認するために,波長 800 nm,パルス幅 100 fs のチタンサファイアレーザー装置を用いシリコーンオイ ルのガラス化を確認した.スピナーコーターでシリコンウ エハ上に約1µm塗布したシリコーンオイルに対して,約 50 mJ/cm²のレーザーパルスを200万パルス照射した.照 射後,干渉分光法により屈折率を評価した.図7に一次元 の屈折率分布,図8に微分干渉顕微鏡による観察像を示す. 幅約3mmにわたりシリコンウェハ表面にガラス化した膜 が残っていることが確認できた.注目する点は,ビーム中 心(位置28.5mm)で最大屈折率1.47を得たことである. これは石英ガラスの屈折率とほぼ同じであり,先述のUV レーザー光照射では得られていない.顕微鏡像では,ガラ ス化した部分の境界がはっきり確認できる.しかし,境界 の周りも黒く位相が変わっている部分がある.これはシリ コン基板がフェムト秒パルスレーザーにより改質したた めと考えられる.波長800 nmの光に対してシリコーンオ イルは透明であり,3光子吸収が起こらない低強度の部分



 図 7 フェムト秒レーザー照射によるガラス 化したシリコーンオイルの屈折率(約50 mJ/cm², 200万パルス)



図 8 フェムト秒パルスレーザーによるガラ ス化したシリコーンオイル

では光は透過する.一方,基板であるシリコンは可視領域 では数 10%吸収するため表面改質が起こったと考えられ る.また,ガラス化した部分のシリコン表面もまた改質し ていると考えられるため,屈折率の解析に影響を及ぼした と思われる.今後ガラス基板上のシリコーンオイルに対し て照射実験を行い,正確な屈折率変化を求める必要がある.

7. 考察およびまとめ

本研究では、レーザー造形法を用いて、石英ガラス表面 に構造を形成することを目的に、レーザー照射によるシリ コーンオイルの屈折率変化を干渉分光法により評価した. またフェムト秒パルスレーザーを用いて、多光子吸収過程 により紫外光と同様にシリコーンオイルのガラス化が可 能であることを実証した.

以下の知見が得られた.

①レーザー照射によるシリコーンオイルのガラス化を 評価するために、分光反射光計測光学系を構築し、干渉分 光法による屈折率解析を確立した.シリコンウェハ上のシ リコーンオイルの変化については高精度と高安定性で評 価が可能であることが分かった.また試料を移動すること により屈折率および膜厚の空間分布も評価可能である.今 後、高分解能、オンラインモニタへと発展が期待できる.

②波長 193 nm の紫外レーザー光により, ガラス化され たシリコーンオイルの屈折率は最大 1.3 であり, ポーラス 状になっていると考えられる.またシリコン-オイルの塗 布と照射を繰り返すことにより,積層しガラス化が可能で あることを示した.これにより当初の目標であるガラス三 次元造形が可能であることが実証できた. ③フェムト秒パルスレーザーによる多光子吸収を利用 し、シリコーンオイルの Si-C 結合を切断、ガラス化が可 能であることを初めて実証した.この結果、ビーム品質の 良いフェムト秒パルスレーザーを用いることにより微小 スポットに集光照射が可能となり、微細な構造形成が可能 である.

今後,更にレーザー照射条件に対するガラス化の精度, 再現性等を評価しながら,透過型回折格子の形成に挑戦す る予定である.

謝 辞

本研究は、公益財団法人天田財団より研究助成(一般研 究開発助成 AF-2019208-B2)により行われた.ここに謝意 を表します.

また本研究の一部は大阪大学レーザー科学研究所の共 同研究として実施された.大阪大学藤岡加奈准教授,近畿 大学吉田実教授に感謝いたします.

参考文献

- 1) 本越伸二:天田財団助成研究成果報告書 2018, AF-2015216
- H.A.Macleod: Thin-Film Optical Filters (訳小倉繁太郎 他, 1989年) p.13.
- 小檜山光信:光学薄膜の基礎理論(オプトロニクス 社,2002年) p.52.